

ニュースリリース

2025 年 9 月 30 日
株式会社ニューフレアテクノロジー

A14 ノード対応のマルチ電子ビームマスク描画装置「MBM™-4000」を上市

株式会社ニューフレアテクノロジー（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：高松潤）は、マルチ電子ビームマスク描画装置の最新シリーズとして A14 ノード（ナノの 1/10 のオンゲストローム世代）対応のマルチ電子ビームマスク描画装置「MBM™-4000」を上市しました。

電子ビームマスク描画装置は、半導体の製造工程における回路原版（フォトマスク）を描画するための装置で、電子光学、精密機械制御、大規模データ処理、レーザ計測技術等の多様且つ高度な技術を統合した装置です。

電子ビームマスク描画装置には、シングル電子ビーム型とマルチ電子ビーム型の 2 種類があります。シングル電子ビーム型が 1 本の電子ビームを使うのに対して、マルチ電子ビーム型は、何十万本もの電子ビームを同時に使って描画する装置であり、より高速かつ高精度な描画が可能になります。

MBM™-4000 は、2nm ノード対応の MBM-3000 に対し、より小さいビームサイズと高い電流密度を採用しており、A14 ノードに必要な解像性と生産性を備えています。

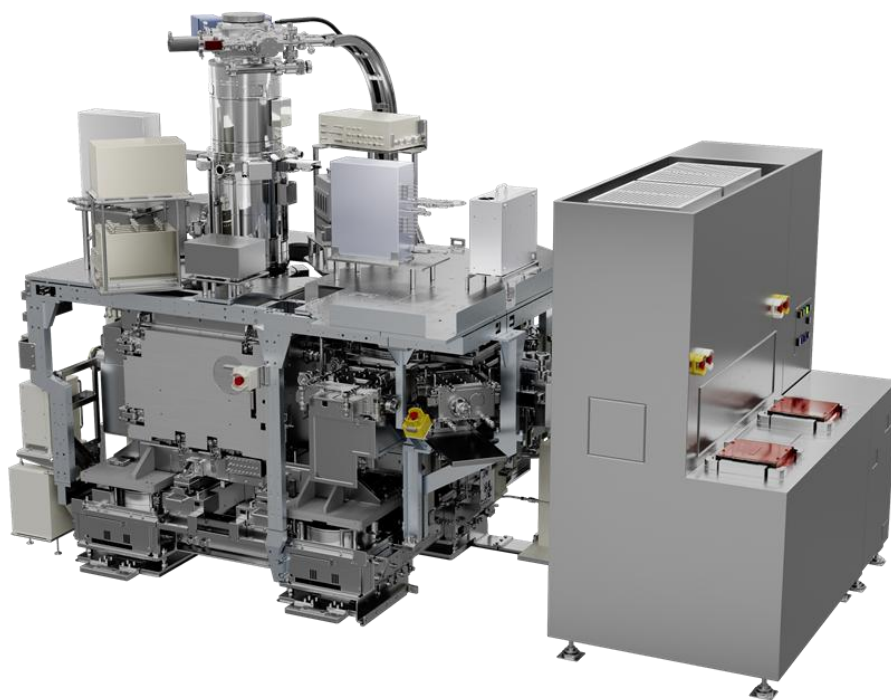
ニューフレアテクノロジーは、今後も半導体製造装置を通じて、新たな価値を創造し、半導体産業と人類、社会に貢献できるよう今後も尽力してまいります。

特長

- 1) 50 万本以上の電子ビームを高速・高精度に制御
- 2) MBM-3000 よりも小さいビームサイズの採用により、高解像性を実現
- 3) データの複雑さに依存しない、高スループットと高精度の描画の両立

仕様

マスクサイズ 6inch
位置精度 1.1nm(3σ)
寸法精度 0.5nm(3σ)



MBM™-4000

以上